

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 3 部門第 3 区分
 【発行日】平成 18 年 1 月 5 日 (2006.1.5)

【公表番号】特表 2005-511876(P2005-511876A)
 【公表日】平成 17 年 4 月 28 日 (2005.4.28)
 【年通号数】公開・登録公報 2005-017
 【出願番号】特願 2003-552839(P2003-552839)
 【国際特許分類】

C 0 8 J 7/00 (2006.01)

C 0 8 L 101/00 (2006.01)

【F I】

C 0 8 J 7/00 3 0 2

C 0 8 J 7/00 C E R

C 0 8 J 7/00 C E Z

C 0 8 L 101:00

【手続補正書】
 【提出日】平成 17 年 10 月 11 日 (2005.10.11)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】全文
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

ポリマー基材の表面を改質するための方法であって：

a) 1 つの表面を有するポリマー基材を提供する工程；

b) 溶媒と、少なくとも 1 種の無機光化学電子供与体と、カチオン助剤とを含む光反応性溶液を、前記基材の表面と接触させて界面を形成させる工程、ここで前記少なくとも 1 種の無機光化学電子供与体は、チオシアン酸塩、硫化物塩、チオ炭酸塩、チオシュウ酸塩、チオリン酸塩、チオ硫酸塩、亜ジチオン酸塩、亜硫酸塩、セレノシアン酸塩、セレン化物塩、アジ化物、アンモニア、ヒドラジン、ヨウ化物、および三ヨウ化物からなる群より選択される；

c) 前記界面を化学線に暴露させる工程；

を含む、ポリマー基材の表面を改質するための方法。

【請求項 2】

改質された表面を有するポリマー基材であって：

a) 1 つの表面を有するポリマー基材を提供する工程；

b) 溶媒と、少なくとも 1 種の無機光化学電子供与体と、カチオン助剤とを含む光反応性溶液を、前記ポリマー基材の表面と接触させて界面を形成させる工程、ここで前記少なくとも 1 種の無機光化学電子供与体は、チオシアン酸塩、硫化物塩、チオ炭酸塩、チオシュウ酸塩、チオリン酸塩、チオ硫酸塩、亜ジチオン酸塩、亜硫酸塩、セレノシアン酸塩、セレン化物塩、アジ化物、アンモニア、ヒドラジン、ヨウ化物、および三ヨウ化物からなる群より選択される；および

c) 前記界面を化学線に暴露させる工程；

を含む方法によって調製される、改質された表面を有するポリマー基材。

【請求項 3】

複合材料物品を調製するための方法であって：

a) 1 つの表面を有するポリマー基材を提供する工程；

b) 1つの表面を有する第2の基材を提供する工程；

c) 溶媒と、少なくとも1種の無機光化学電子供与体と、カチオン助剤とを含む光反応性溶液を、薄膜として、前記ポリマー基材の表面の上にコーティングして、第1の界面を形成させる工程；

d) 前記第2の基材の表面を前記コーティングした光反応性溶液と接触させて第2の界面を形成させる工程；および

e) 両方の界面を同時に、複合材料物品を形成させるのに十分な化学線に暴露させる工程；

を含む、複合材料物品を調製するための方法。

【請求項4】

複合材料物品であって：

a) 1つの表面を有するポリマー基材を提供する工程；

b) 1つの表面を有する第2の基材を提供する工程；

c) 溶媒と、少なくとも1種の無機光化学電子供与体と、カチオン助剤とを含む光反応性溶液を、薄膜として、前記ポリマー基材の表面の上にコーティングして、第1の界面を形成させる工程；

d) 前記第2の基材の表面を前記コーティングした光反応性溶液と接触させて第2の界面を形成させる工程；および

e) 両方の界面を同時に、複合材料物品を形成させるのに十分な化学線に暴露させる工程；

を含む方法により調製された、複合材料物品。